(11)Publication number:

63-277582

(43)Date of publication of application: 15.11.1988

(51)Int.CI.

CO4B 38/00

(21)Application number: 62-112717

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing :

08.05.1987

(72)Inventor: SAEGUSA KUNIO

FUJITA HIROYUKI KADOKURA HIDEKIMI

(54) PRODUCTION OF POROUS LEAFLETS

(57)Abstract

PURPOSE: To enable simple production of the title substance which is used in slow releasing agents for perfume or external use medicines, by dissolving a specific substance in a solution, forming leaf flakes from the solution and removing the specific substance from the leaves.

CONSTITUTION: (A) A solution or dispersion of (a) a substance for making leaf flakes such as metal oxide or hydroxide in (b) a solvent such as water or butanol (silica sol or the like) is combined with (B) at least one selected from (c) substances which are removable from the leaf flakes and soluble in the solution A or (d) substances which are removable from the leaf flakes and insoluble in the solution A with particle sizes of less than 5μ (polyethylene glycol or fine particles of silica) to form a solution or dispersion for making leaf flakes. leaf flakes are formed from the solution and component B is re moved, e.g., by heating at $300W1,000^{\circ}$ C or dissolving with an acid or alkali. Leaf flakes of $0.1W5\mu m$ average thickness, $1W500\mu m$ and 3W100 aspect ratio are obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 277582

(5) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)11月15日

C 04 B 38/00

3 0 3

Z-8618-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

69発明の名称

多孔質薄片状物質の製造法

願 昭62-112717 ②特

願 昭62(1987)5月8日 四出

⑫発 明 者 \equiv 枝 邦 夫

公

愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

79発 明 者

之 Ħ 宕

愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

藤 倉 門 秀 ⑫発 明 者

愛媛県新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

住友化学工業株式会社 ①出 顖

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

弁理士 諸石 光凞 の代 理

外1名

1. 発明の名称

多孔質薄片状物質の製造法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 薄片を形成する物質の溶液または分散液中に、 薄片形成後薄片中より除去可能でかつ該溶液ま たは該分散液に可溶な物質か、或いは薄片形成 後薄片中より除去可能でかつ粒子径が5 4 以下 で該溶液または分散液に不溶な物質の少なくと も1種を溶解または分散し薄片化原液とし、該 原液を用いて薄片を形成した後、該薄片中より 除去可能な物質を除去することを特徴とする多 孔質薄片状物質の製造法。
 - ②薄片を形成する物質が金属酸化物または金属水 酸化物であることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の多孔質薄片状物質の製造法。
 - (3) 製造される多孔管護片状物管の平均の厚みが 0.1~5 µ、平均の大きさが1~500 µ であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の多孔質薄片状物質の製造法。

- (4) 除去可能な物質が有機高分子物質であること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の多孔 質薄片状物質の製造法。
- (5) 除去可能な物質が酸或いはアルカリに可溶な 金属、金属酸化物、金属水酸化物であることを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の多孔質 薄片状物質の製造法。
- (6) 製造される多孔質薄片状物質の気孔の直径が 0.01~2.5 µ であることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載の多孔質薄片状物質の製造
- 3. 発明の詳細な説明
 - (産業上の利用分野)

本発明は、内部及び表面に気孔を有すること を特徴とする多孔質薄片状物質の製造法に関す

(従来の技術)

従来より多孔質無機物質を製造する方法は、 種々知られている。

例えば、セラミック原料を混合したポリウレ

タン発泡体を焼成してウレタンを除去するとともに、セラミック原料を焼結させて多孔質体のセラミック焼成体を得る方法。(特公昭54-12927号公報、特開昭 60-195073号公報)

またセラミック薄膜に高速荷電粒子を照射することによって、飛路孔を形成し、次いで化学エッチングを施すことによって多孔質セラミック薄膜を製造する方法が知られている。 (特別昭 60-239375号公報)

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、ポリウレタン発泡体を用いる方法の場合には得られる孔の大きさは、数百 μ ~ 数 m で あり、大きさが 1 0 μ 程度の 薄片への 開孔方法を 数示するものではない。

また、前述のセラミック薄膜に高速荷電粒子 を照射し飛跡孔を形成する方法は、微細な孔を 作ることができるが、装置が大掛かりであり、 しかも薄片のように必ずしも一定の向きに並ん でいないものを処理することは殆ど不可能である。

本発明の実施にあたり、薄片を形成する物質 の溶液または分散液を形成するためにもちいる 溶媒としては、常温で液体であればよく、この ようなものの例としては水;メタノール、エタ ノール、イソプロパノール、ブタノール、アミ ルアルコール、セチルアルコール等のアルコー ル類:ベンゼン、トルエン、キシレン、スチレ ン等の芳香族炭化水素類:ヘキサン、オクタン、 ドデカン等の脂肪族炭化水素類;アセトン、メ チルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等 のケトン類;ジエチルエーテル、ジブチルエー テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエ ーテル類:酢酸、プロピオン酸、イソステアリ ン酸等のカルボン酸類;酢酸エチル、酢酸イソ プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル等 のエステル類等があげられる。

本発明の実施にあたり、薄片を形成する物質 としては、それ自体が液状である金属化合物、 適当な溶媒に溶解している金属化合物の溶液、 金属化合物グルから選ばれる。 このように従来、多れるの無機成形体及び無機薄膜については知られていたが、多孔質の無機薄片の製造方法については全く知られていなかった。

かかる事情下に鑑み本発明者等は微細な気孔を有する多孔質薄片の廉価で容易な製造法を見出すべく鋭意検討した結果本発明を完成するに 至った。

〈問題点を解決するための手段〉

すなわち本発明は、薄片を形成する物質の溶 被または分散液中に薄片形成後薄片中より除去 可能でかつ該溶液または該分散液に可溶な物質 か、或いは薄片形成後薄片中より除去可能でか つ粒子径が5 μ以下で該溶液または分散液に 溶な物質の少なくとも1種を溶解または分散 溶け化原液とし、該原液を用いて薄片を形成し た後、該薄片中より除去可能な物質を除去する ことを特徴とする多孔質薄片状物質の製造法を 提供するにある。

以下に本発明を更に詳細に述べる。

詳しくは、一般式MXnOm(式中、Mは金属元素、Xはアルキル基、アルコキシ基、アシロキシ基、水酸基またはハロゲンより選ばれた1種または2種以上、Oは酸素、n、mは整数でn+2m=金属元素の価数である。)で示される金属化合物またはこれらのポリマー自身またはその溶液であり、他の一つは金属酸化物、金属水酸化物、金属硫酸塩、有機金属ポリマー等のゾル等である。

本発明の金属化合物の金属としては、2 価以上の金属、好ましくは周期表 II b、 IV a または IV b 族に属する金属、更に具体的には、アルミニウム、ケイ素、チタニウム、ジルコニウム、スズより選ばれた 1 種または 2 種以上の金属が用いられる。

本発明の金属化合物のアルキル基としては、 メチル基、エチル基、ブチル基、ペンチル基、 ラウリル基等;アルコキシ基としては、メトキ シ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、 ペントキシ基等;アシロキシ基としては、アセ トキシ苺、プロピオニAma キシ苺、ブチリルオキシ苺等が挙げられる。

このような金属化合物としては、モノエチル ジエトキシアルミニウム、モノメチルジプトキ シアルミニウム、モノエチルジペントキシアル ミニウム、ジメチルモノメトキシアルミニウム、 ジイソプロピルモノエトキシアルミニウム、ジ メチルモノイソプロポキシアルミニウム、ジエ チルモノペントキシアルミニウム等のアルキル アルコキシアルミニウム類:トリメトキシアル ミニウム、トリエトキシアルミニウム、トリイ ソプロポキシアルミニウム、トリプトキシアル ミニウム、トリペンドキシアルミニウム等のト リアルコキシアルミニウム額:モノクロルジエ トキシアルミニウム、モノクロルジイソプロポ キシアルミニウム、モノクロルジペントキシア ルミニウム、ジクロルモノメトキシアルミニウ ム、ジクロルモノプトキシアルミニウム、ジブ ロムモノメトキシアルミニウム等のハロゲン化 アルコキシアルミニウム類;三塩化アルミニウ

ム、三臭化アルミニウムーのハロゲン化アルミ ニウム類:モノクロルジエチルアルミニウム、 モノクロルジイソプロピルアルミニウム、モノ クロルジブチルアルミニウム、モノクロルジベ ンチルアルミニウム、モノブロムジメチルアル ミニウム、モノアイオドジエチルアルミニウム、 ジクロルモノエチルアルミニウム、ジクロルモ ノブチルアルミニウム、ジアイオドモノエチル アルミニウム等のハロゲン化アルキルアルミニ ウム類:モノブチルジアセトキシアルミニウム、 モノメチルジプロピオニルオキシアルミニウム、 モノイソプロピルジブチリルオキシアルミニウ ム、ジメチルモノアセトキシアルミニウム、ジ メチルモノプロピオニルオキシアルミニウム筈 のアルキルアシロキシアルミニウム類:トリア セトキシアルミニウム、トリプロピオニルオキ シアルミニウム、トリブチリルオキシアルミニ ウム、トリペンタノイルオキシアルミニウム等 のトリアシロキシアルミニウム粗:モノクロル ジアセトキシアルミニウム、モノブロムジアセ

トキシアルミニウム、ジクロルモノイソプロピ オニルオキシアルミニウム、ジブロムモノアセ トキシアルミニウム等のハロゲン化アシロキシ アルミニウム類;モノメトキシジアセトキシア ルミニウム、モノエトキシジプロピオニルオキ シアルミニウム、ジブトキシモノアセトキシア ルミニウム、ジエトキシモノブチリルオキシア ルミニウム等のアルコキシアシロキシアルミニ ウム類:モノメチルトリメトキシシラン、モノ ブチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエ トキシシラン、モノエチルトリペントキシシラ ン、ジエチルジメトキシシラン、ジイソプロピ ルジエトキシシラン、トリプチルモノメトキシ シラン、トリメチルモノエトキシシラン、トリ イソプロピルモノエトキシシラン、トリエチル モノペントキシシラン等のアルキルアルコキシ シラン類:テトラメトキシシラン、テトラエト キシシラン、テトライソプロポキ シシラン、テ トラブトキシシラン、テトラペントキシシラン 等のテトラアルコキシシラン類:モノクロルト

リメトキシシラン、モノクロルトリプトキシシ ラン、モノブロムトリメトキシシラン、ジクロ ルジプトキシシラン、ジアイオドジエトキシシ ラン、トリクロルモノメトキシシラン、トリク ロルモノペントキシシラン、トリプロムモノメ トキシシラン等のハロゲン化アルコキシシラン 類;四塩化ケイ素、四臭化ケイ素等のハロゲン 化ケイ素類;モノクロルトリメチルシラン、モ ノクロルトリペンチルシラン、モノプロムトリ メチルシラン、モノアイオドトリエチルシラン、 ジクロルジメチルシラン、ジクロルジペンチル シラン、トリクロルモノエチルシラン、トリク ロルモノイソプロピルシラン、トリプロムモノ メチルシラン等のハロゲン化アルキルシラン額 : モノメチルトリアセトキシシラン、モノメチ ルトリプロピオニルオキシシラン、モノイソプ ロピルトリプチリルオキシシラン、ジェチルジ アセトキンシラン、ジエチルジプロピオニルオ キシシラン、トリメチルモノアセトキシシラン、 トリプチルモノアセトキシシラン、トリエチル

モノブチリルオキシ 等のアルキルアシロ キシシラン類;テトラアセトキシシラン、テト ラプロピオニルオキシシラン、テトラブチリル オキシシラン、テトラペタノイルオキシシラン 等のテトラアシロキシシラン類:モノクロルト リアセトキシシラン、モノクロルトリブチリル オキシシラン、モノブロムトリアセトキシシラ ン、ジクロルジアセトキシシラン、トリクロル モノアセトキシシラン、トリプロムモノアセト キシシラン等のハロゲン化アシロキシシラン類: モノブトキシトリアセトキシシラン、モノエト キシトリプロピオニルオキシシラン、モノイソ プロポキシトリプチリルオキシシラン、ジエト キシジアセトキシシラン、ジイソプロポキシジ ブチリルオキシシラン、トリプトキシモノアャ トキシシラン等のアルコキシアシロキシシラン。 類:モノメチルトリメトキシチタニウム、モノ ブチルトリメトキシチタニウム、モノメチルト リエトキシチタニウム、モノエチルトリペント キシチタニウム、ジエチルジメトキシチタニゥ

ム、ジイソプロピルジ ⁷キシチタニウム、ト リプチルモノメトキシチタニウム、トリメチル モノエトキシチタニウム、トリイソプロピルモ ノエトキシチタニウム、トリエチルモノペント キシチタニウム等のアルキルアルコキシチタニ ウム類;テトラメトキシチタニウム、テトラエ トキシチタニウム、テトライソプロポキシチタ ニウム、テトラブトキシチタニウム、テトラペ ントキシチタニウム等のテトラアルコキシチタ ニウム類;モノクロルトリメトキシチタニウム、 モノクロルトリプトキシチタニウム、モノブロ ムトリメトキシチタニウム、ジクロルジプトキ シチタニウム、ジアイオドジエトキシチタニウ ム、トリクロルモノメトキシチタニウム、トリ クロルモノペントキシチタニウム、トリブロム モノメトキシチタニウム等のハロゲン化アルコ キシチタニウム類;四塩化チタニウム、四臭化 チタニウム等のハロゲン化チタニウム類:モノ クロルトリメチルチタニウム、モノクロルトリ ペンチルチタニウム、モノブロムトリメチルチ

タニウム、モノアイオドトリエチルチタニウム、 ジクロルジメチルチタニウム、ジクロルジペン チルチタニウム、トリクロルモノエチルチタニ ウム、トリクロルモノイソプロピルチタニウム、 トリプロムモノメチルチタニウム等のハロゲン 化アルキルチタニウム類;モノメチルトリアセ トキシチタニウム、モノメチルトリプロピオニ ルオキシチタニウム、モノイソプロピルトリブ チリルオキシチタニウム、ジエチルジアセトキ シチタニウム、ジエチルジプロピオニルオキシ チタニウム、トリメチルモノアセトキシチタニ ウム、トリプチルモノアセトキシチタニウム、 トリエチルモノブチリルオキシチタニウム等の アルキルアシロキシチタニウム額:テトラアセ トキシチタニウム、テトラプロピオニルオキシ チタニウム、テトラブチリルオキシチタニウム、 テトラペンタノイルオキシチタニウム等のテト ラアシロキシチタニウム類;モノクロルトリア セトキシチタニヴム、モノクロルトリプチリル オキシチタニウム、モノブロムトリアセトキシ

チタニウム、ジクロルジアセトキシチタニウム、 トリクロルモノアセトキシチタニウム、トリブ ロムモノアセトキシチタニウム等のハロゲン化 アシロキシチタニウム類;モノブトキシトリア セトキシチタニウム、モノエトキシトリプロピ オニルオキシチタニウム、モノイソプロポキシ トリプチリルオキシチタニウム、ジェトキシジ アセトキシチタニウム、ジィソプロポキシジブ チリルオキシチタニウム、トリブトキシモノア セトキシチタニウム等のアルコキシアシロキシ チタニウム類:モノメチルトリメトキシジルコ ニウム、モノブチルトリメトキシジルコニウム、 モノメチルトリエトキシジルコニウム、モノェ チルトリペントキシジルコニウム、ジェチルジ メトキシジルコニウム、ジイソプロピルジェト キシジルコニウム、トリブチルモノメトキシジ ルコニウム、トリメチルモノエトキシジルコニ ウム、トリイソプロピルモノエトキシジルコニ ウム、トリエチルモノペントキシジルコニウム 等のアルキルアルコキシジルコニウム類:テト

ラメトキシジルコニウム、テトラエトキシジル コニウム、テトライソプロポキシジルコニウム、 テトラブトキシジルコニウム、テトラペントキ シジルコニウム等のテトラアルコキシジルコニ ウム類;モノクロルトリメトキシジルコニウム、 モノクロルトリプトキシジルコニウム、モノブ ロムトリメトキシジルコニウム、ジクロルジブ トキシジルコニウム、ジアイオドジェトキシジ ルコニウム、トリクロルモノメトキシジルコニ ウム、トリクロルモノペントキシジルゴニウム、 トリプロムモノメトキシジルコニウム等のハロ ゲン化アルコキシジルコニウム類:四塩化ジル コニウム、四臭化ジルコニウム等のハロゲン化 ジルコニウム類:モノクロルトリメチルジルコ ニウム、モノクロルトリペンチルジルコニウム、 モノプロムトリメチルジルコニウム、モノアイ オドトリエチルジルコニウム、ジクロルジメチ ルジルコニウム、ジクロルジペンチルジルコニ ウム、トリクロルモノエチルジルコニウム、ト リクロルモノイソプロピルジルコニウム、トリ

プロムモノメチルジルコニウム等のハロケン化 アルキルジルコニウム類;モノメチルトリアセ トキシジルコニウム、モノメチルトリプロピオ ニルオキシジルコニウム、モノイソプロピルト リプチリルオキシジルコニウム、ジエチルジア セトキシジルコニウム、ジエチルジプロピオニ ルオキシジルコニウム、トリメチルモノアセト キシジルコニウム、トリプチルモノアセトキシ ジルコニウム、トリエチルモノブチリルオキシ ジルコニウム等のアルキルアシロキシジルコニ ウム類;テトラアセトキシジルコニウム、テト ラプロピオニルオキシジルコニウム、テトラブ チリルオキシジルコニウム、テトラペンタノイ ルオキシジルコニウム等のテトラアシロキシジ ルコニウム類;モノクロルトリアセトキシジル コニウム、モノクロルトリプチリルオキシジル コニウム、モノブロムトリアセトキシジルコニ ウム、ジクロルジアセトキシジルコニウム、ト リクロルモノアセトキシジルコニウム、トリブ ロムモノアセトキシジルコニウム等のハロゲン

化アシロキシジルコニウム類:モノブトキシト リアセトキシジルコニウム、モノエトキシトリ プロピオニルオキシジルコニウム、モノイソプ ロポキシトリブチリルオキシジルコニウム、ジ エトキシジアセトキシジルコニウム、ジィソプ ロポキシジブチリルオキシジルコニウム、トリ ブトキシモノアセトキシジルコニウム等のアル コキシアシロキシジルコニウム類、モノメチル トリメトキシスズ、モノブチルトリメトキシス ズ、モノメチルトリエトキシスズ、モノエチル トリペントキシスズ、ジエチルジメトキシスズ、 ジイソプロピルジエトキシスズ、トリプチルモ ノメトキシスズ、トリメチルモノエトキシスズ、 トリイソプロピルモノエトキシスズ、トリエチ ルモノペントキシスズ等のアルキルアルコキシ スズ類;テトラメトキシスズ、テトラエトキシ スズ、テトライソプロポキシスズ、テトラブト キシスズ、テトラペントキシスズ等のテトラア ルコキシスズ類:モノクロルトリメトキシスズ、 モノクロルトリプトキシスズ、モノブロムトリ

メトキシスズ、ジクロルジプトキシスズ、ジァ イオドジエトキシスズ、トリクロルモノメトキ シスズ、トリクロルモノペントキシスズ、トリ プロムモノメトキシスズ等のハロゲン化アルコ キシスズ類;四塩化スズ、四臭化スズ等のハロ ゲン化スズ類:モノクロルトリメチルスズ、モ ノクロルトリペンチルスズ、モノブロムトリメ チルスズ、モノアイオドトリエチルスズ、ジク ロルジメチルスズ、ジクロルジペンチルスズ、 トリクロルモノエチルスズ、トリクロルモノイ ソプロピルスズ、トリプロムモノメチルスズ等 のハロゲン化アルキルスズ類:モノメチルトリ アセトキシスズ、モノメチルトリプロピオニル オキシスズ、モノイソプロピルトリプチリルオ キシスズ、ジエチルジアセトキシスズ、ジエチ ルジプロピオニルオキシスズ、トリメチルモノ アセトキシスズ、トリプチルモノアセトキシス ズ、トリエチルモノブチリルオキシスズ等のア ルキルアシロキシスズ類:テトラアセトキシス ズ、テトラプロピオニルオキシスズ、テトラブ

チリルオキシスズ、テトラペンタノイルオキシスズ、テトラペンタノイルオキシスズ、テトラペンタリカロルトリアセトキシスズ、モノクロルトナリアセトキシスズ、トリクロルモノアセトキシスズ、トリクロルジアセトキシスズ、トリクロルジアセトキシスズ、トリクロルジアセトキシスズ、トリカーキシスズ、テリカーキシスズ、デリー・カーシスズ、デリー・カーシスズ、デリー・カーシスズ、デリー・カーシスズ、デリー・カーシスズの混合物が挙げられる。

また、これら金属化合物のポリマーは、金属 化合物に水とかカルボン酸を反応させることに よって得られる。

この時必要に応じて塩酸、硫酸、苛性ソーダ、 アンモニア等を触媒として用いてもよい。

ポリマーの例としては、ポリエトキシアルミ

特に制限されるものではないが、あまりに希薄 すぎると飛散させる溶媒が多くなり、経済的で ない。

一方、湿厚すぎると作業性が低下することも あるので、一般的には2~80重量%程度で用 いられる。

金属化合物ゾルについては、適当な分散媒中でゾルとなる金属化合物であればなんでもよいが、例えば金属酸化物、金属水酸化物、金属硫 化物、あるいは金属塩化物、金属硫酸塩等の金 属塩、有機金属ボリマー等が挙げられる。

該金属化合物の金属としては、2 価以上の金属、好ましくは周期表 Ⅲ b、 № a または № b 族に属する金属、更に好ましくは、アルミニウム、ケイ素、チタニウム、ジルコニウム、スズより選ばれた1 種または2 種以上の金属が用いられる。

具体的には、アルミナ、水酸化アルミニウム、 硫化アルミニウム、塩化アルミニウム、オキシ 塩化アルミニウム、塩蒸性塩化アルミニウム、 ノキサン、ポリ (アセトキシーブトキシ) シロキサン、ポリイソプロポキシチタノキサン、ポリ リ (ブチルーエトキシ) ジルコノキサン、ポリ (オクチルークロル) スタノキサン等のポリメ タロキサンが挙げられる。

このような金属化合物またはポリマーは常温 で液状または固体である。

使用時には液体でなければならないので、固体の場合には加熱酸解させるとか、適当な溶媒 に溶解させて用いる。

また、常温で液体の場合でも適当な濃度の調節の為に溶媒に溶解して用いても良い。

使用する溶媒は、金属化合物の種類によって 異なるが、メタノール、エタノール等のアルコ ール類、ヘキサン、デカン、シクロヘキサン等 の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素類、アセトン等のケトン類、水 及びこれらの混合系が好適に用いうる。

金属化合物溶液からなる原液中の金属化合物 の濃度は金属化合物の種類によっても異なり、

ポリ塩化アルミニウム、硫酸アルミニウム、酢 酸アルミニウム、シュウ酸アルミニウム、アル ミニウムイソプロポキシドのポリマーのような アルミニウムアルコキシド類のポリマー、トリ エチルアルミニウムのポリマーのようなアルキ ルアルミニウム類のポリマー等のアルミニウム 化合物、シリカ、オキシ塩化ケイ素、酢酸ケイ 素、シュウ酸ケイ素、テトラエチルシリケート のポリマーのようなアルコキシシラン類のポリ マー、ジメチルジクロルシランのポリマーのよ うなアルキルクロルシラン類のポリマー等のケ イ素化合物、チタニア、水酸化チタニウム、硫 化チタニウム、オキシ塩化チタニウム、硫酸チ タニウム、酢酸チタニウム、シュウ酸チタニウ ム、チタニウムイソプロポキシドのポリマーの ようなチタニウムアルコキシド類のポリマー、 チタニウムアセチルアセトナート等のチタニウ ム化合物、酸化ジルコニウム、水酸化ジルコニ ウム、硫化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニ ウム、硫酸ジルコニウム、酢酸ジルコニウム、

シュウ酸ジルコニウム・ノルコニウムイソプロ ポキシドのポリマーのようなジルコニウムアル コキシド類のポリマー、ジルコニウムアセチル アセトナート等のジルコニウム化合物、酸化ス ズ、水酸化スズ、硫化スズ、塩化スズ、オキシ 塩化スズ、塩基性塩化スズ、硫酸スズ、酢酸ス ズ、シュウ酸スズ、スズイソプロポキシドのポ リマーのようなスズアルコキシド類のポリマー、 モノオクチルトリプトキシスズのポリマーのよ うなアルキルアルコキシスズ類のポリマー等の スズ化合物等が挙げられる。

このような金属化合物は常温で液状または固 体である。

使用時には液状ゾルでなければならないので、 水、有機溶媒等の適当な分散媒に分散させる。

使用する分散媒は、金属化合物の種類によっ て異なるが、水:メタノール、エタノール等の アルコール類;ヘキサン、デカン、シクロヘキ サン等の脂肪族炭化水素類;トルエン、キシレ ン等の芳香族炭化水素類;アセトン等のケトン

が知られている。

またアルミナゾルを調製する時には、酢酸ア ルミニウムのような加水分解性の化合物を加熱 等の手段により加水分解することによってゾル 化する方法等が良く知られている。(新しい工 業材料の科学、シリカとアルミナ(コロイド製 品) 59頁~127頁、化学便覧応用編(改訂 3版)、132頁日本化学会編)。

更に特殊なゾルにしたい場合は、上述の文献 等に記述されている公知の方法によって、調整 することも可能である。

またゾルの安定化のために、適当なpH調整 剤、たとえば少量の塩酸や苛性ソーダ等と添加 すると効果がある。

薄片中に溶解または分散する物質としては、 薄片を形成する物質と物理的もしくは化学的性 質が異なっていて、母体から除去可能な物質で あれば何でもよく、除去方法によって物質は異 なる。

除去方法としては焼成、酸またはアルカリま

類及びこれらの混合系が好適に用いうる。

金属化合物ゾルの湿度は金属化合物の種類に よっても異なり、特に制限されるものではない が、あまりに希薄すぎると揮散させる分散媒が 多くなり、経済的ではない。

一方、湿厚すぎると作業性が低下することも あるので、一般的には2~50重量%程度で用 いられる。

なお、水系市販ゾルとして、例えばシリカゾ ルでは、デュポン社製のルドックス®HS-4 0、アルミナゾルでは日産化学工業機製の商品 名でアルミナゾル100等がある。

また有機溶媒分散系としては日産化学工業的 製の商品名メタノールシリカゾル等が知られて いる。

これらのゾルの調製法としては、例えばシリ カゾルを顕製する時には、水ガラスからイオン 交換によって作る方法とか、水ガラスを酸で中 和する方法とか、水ガラスを電気透析する方法 とか、エチルシリケートを加水分解する方法等

たは溶媒による溶解除去等が考えられる。

例えば焼成によって除去する場合とか、溶媒 によって除去する場合には除去物質として有機 高分子物質が好ましい。

- 有機高分子物質の例としては、水溶性のポリ ビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロ キシプロピルセルロール、ポリエチレングリコー ル、アラピアゴム、アルギン酸ソーダ、カルボ キシメチルセルロース、でんぷん等が、有機溶 媒に溶解する高分子物質の例としては、酢酸ビ ニル、EVA、ブチルゴム、エチルセルロース、 ニトロセルロース、ブタジエンゴム、ポリスチ レン、ポリピニルプチラール、エポキシ樹脂、 フェノール樹脂、ポリメチルメタクリレート等 が挙げられる。

これらは300~1000での加熱により、 容易に除去できる。

また水、アルコール、芳香族炭化水素等の適 当な溶媒に可溶であるので、薄片中より該有機 高分子物質のみを溶出するような方法を採用す るときにも使用できる

また、酸による溶解の場合は、酸に可溶な金 属、金属酸化物、金属水酸化物等の微粒子が適 当である。

アルカリによる溶解の場合には、アルカリに

必ずしも限定されるものではないが、一般的には2~50容量%の範囲で、あまり気孔率が低いと多孔質の特徴が出にくく、また気孔率が高いと薄片の強度が低下する。

従って気孔形成用物質の配合量は、多孔質薄片の気孔率、これらの範囲になるように調整される。

また、気孔の大きさは最大でも薄片の厚み以下である必要があり、用途によっても異なるが、 厚みの1/2以下が好ましい。

また極端に小さな、例えば 0.001 µ程度の 気孔は、気孔中に香料や薬品を保持させる等の 実質的な効果は少ない。

従って、気孔の大きさは一般に 0.0 0 1 μ以上~薄片の厚み (最大 5 μ) 以下であり、好ましくは 0.0 1 μ以上~薄片の厚みの 1 / 2 (最大 2.5 μ) 以下である。

気孔形成用物質として、微粒子を分散する場合には、この粒子の大きさが空孔の大きさと直接関係してくるので、微粒子の大きさは約0.0

可溶な金属、金属の酸化が、水酸化物の微粒子が適当である。

例えば酸化スズ、シリカ、アルミナ、酸化亜 鉛、水酸化スズ、水酸化アルミニウム、水酸化 亜鉛等が挙げられる。

薄片を形成する物質の薄片化原液中の湿度は 金属化合物に換算して2度量%~50重量%の 範囲に、好ましくは5重量%~30重量%の範 囲に調整される。

濃度が2 重量%以下であると、あまりに濃度 が低くて経済的でなく、また50重量%を超え ると著しく高粘度になったり、液がゲル化また は沈森を起しやすくなったりして、作業性が低 下する。

気孔形成用物質(薄片形成後除去する物質) の配合量は、多孔質薄片に導入すべき気孔の大 きさ、数等により異なり、また気孔形成用物質 の薄片化原液への溶解性、分散性によっても上 限が規制される。

薄片の気孔率は、その使用目的により異なり、

0 1 μ以上、約 5 μ以下である必要があり、好 ましくは約 0.0 1 μ以上、約 2.5 μ以下である。

気孔形成用物質として、高分子物質を薄片化原液に溶解する場合には、その分子量等は、特に制限はなく、孔の大きさは、その高分子物質と薄片化原液の親和性や配合量により、高分子物質の凝集状態等を変化させる事により制御できる。

気孔形成用物質の溶解、または分散方法は通常用いられている方法、すなわち撹拌、加熱による溶解や、超音波やホモジナイザーによる分散等が好適に用いうる。

本発明の実施に際し、気孔形成用物質を溶解及び/または分散した薄片化原液からの薄片の形成方法としては、特にその製造方法を制限されるものではないが、例えば気孔形成用物質として有機高分子を金属アルコキシド溶液に溶解後、米国特許第2.941.895号明細書、特開昭 60-176906号公報等に記載されている如く平滑面上に塗布し、該塗膜を水または水蒸気

によって加水分解物を (一ない、金属アルコキシド部分加水分解物をマトリックスとした有機高分子を分散含有する薄膜状物質を得た後、これをスクレーパー等で剝離し空気中で焼成する事によって、金属酸化物の多孔質薄片状物質を得る事が出来る。

更にこれを、再び炭素存在下等の還元性雰囲 気で焼成すれば、主として金属炭化物よりなる 多孔質薄片状物質が得られる。

更に焼成を炭素の存在下窒素雰囲気で焼成すれば主として金属窒化物をマトリックスとした 多孔質薄片状物質が得られる。

また、硫酸チタン水溶液にアルカリに可溶な 微粒金属化合物を分散して、米国特許第3.0 18.186号明細書等に示されているような 薄片状物質の製造方法によって微粒金属化合物 を分散含有する薄片状酸化チタンを得ることが できる。

これをアルカリで処理することによって、多 孔質薄片状酸化チタンを得ることができる。

ち、特顧昭61-82486号に示すような方法で薄片 化しても良い。

このような有機高分子含有金属酸化物薄片を 空気中で焼成し、有機高分子を除くことにより、 多孔質薄片を得ることができる。

このようにして、多孔質薄片状物質を得ることができる。

このようにして得られた多孔質薄片状物質は 次いで特定の形状に調整される。

核形状は用途により一義的ではないが通常平均の厚み約 0.1μ m~約 5μ m、好ましくは約 0.2μ m~約 2μ m平均の大きさ約 1μ m~約 $5 0 0 \mu$ mである。

薄片の厚みが約0.1 μmより薄いと、機械的 強度が低く、実用に耐えない。

厚みが約5μmより厚いと化粧料の適用に際 し唐へのつきや、使用時の窓触が悪くなる。

薄片の平均の大きさが約1μmより小さいと、 薄片の形状を保ちにくく、約500μmを越え

また、有機高分子を水ガラスや、リン酸アル ミニウム溶液のような無機高分子に分散したの

ると、壊れやすくなる。

また、薄片状物質のアスペクト比

(アスペクト比= (薄片の平均の大きさ) / (薄片の平均の厚み))

は3以上100以下が好ましい。

アスペクト比が3以下の場合には展延性のような薄片の特徴があまりです、100以上のときには、機械的に壊れやすくなるので好ましくない。

薄片は一般に分布を持つため、本発明において大きさは平均の大きさ、即ち100個の薄片についての

(薄片の最長さしわたし径+最短さしわたし径) / 2 の値の平均値で規定し、厚みも平均の厚み、 即ち1 0 0 個の薄片についての平均値で規定した。

そして、特定の大きさに薄片状物質を調整する方法としては、前記の方法によって得られた 薄片状物質を乾式ボールミル、湿式ボールミル、 振動ミル、ロールミル、ゼットミル等による粉 存及び/またはジャイフターやハンマースクリーンのような振動ふるい、スパイラル分級器のような湿式分級法、動式または遠心式の風力分級器のような乾式分級法をあるいは浮遊選鉱法等のような分級工程の1つまた2つ以上を組み合わせる方法等の周知の方法(例えば粉体工学ハンドブック、井伊谷鋼ー編集、朝倉書店発行)を採用すればよい。

こうして得られた多孔質薄片状物質は、その 気孔中に香料や薬品を保持させる事により、保 香剤とか、徐放性外用薬として用いることがで き、ファンデーション、白粉、リップスティッ ク、アイシャドー等の化粧料や、湿布、消毒用 飲コウ等の外用薬に配合される。

多孔質薄片状物質の化粧料や外用薬への配合 割合は、用途によっても異なり一義的ではない が、通常 0. 1 重量 %~ 7 0 重量 %、好ましくは 0. 5 重量 %~ 4 0 重量 %の範囲で配合される。

薄片状物質が 0.1 重量 % 未満の時は、その効果が充分でなく、他方 7 0 重量 % を越えるとし

っとり感等の使用時のこれが低下する。

更に、本発明において多孔質薄片状物質を配合する場合、分散性、使用性を向上させる目的で通常使用される油脂原料による表面被覆処理、界面活性剤処理或いはステアリン酸亜鉛等の金属石鹼処理等の表面処理を行ってから配合してもよい。

これらの多孔質薄片状物質を化粧料に配合する方法としては、公知の混合方法、即ちヘンシェルミキサー、リボンミキサー、 V型プレンダー等を用いることができる。

(発明の効果)

以上詳述した本発明法によれば薄片状物質形成用原液に気孔形成用物質を溶解或いは分散させ、この原液を用いて薄片を形成後、薄片中に溶解或いは分散している物質を焼成や溶解等の方法により除去するという極めて簡単な方法で多孔質薄片状物質の製造を可能としたもので、その産業的価値は頗る大なるものである。

(実施例)

以下本発明を実施例により具体的に説明する。 実施例1

シリカゾル (ルドックス H S - 4 0 ® 、 E . 1 . d u P o n t 姆製)を、シリカ濃度が 2 0 重量 %になるように水で希釈し、これにポリエチレングリコール (分子量 2 0 0 0 0)をシリカに対して 2 0 重量 %となるように添加溶解して薄片化原料液とした。

これをバットに入れ、直径10cmのロールを 室温で、この液に浸漬し、2m/分の周速で回 転させた。

次に原液の付着したロール上に、120での空気が渡速1m/秒であたるように渡し液膜の水は除去しロール上にシリカーポリエチレングリコールのゲル状フィルムを得た。 該フィルムは体積収縮によりひび割れが生じるまで乾燥した後ひび割れにより生じた薄片をスウェーデン 鋼製のスクレーパーで掻き取った。

得られた薄片を 6 0 0 ℃で焼成して、大きさ 1 0 ~ 2 5 μ、厚み 2 μの薄片状シリカを得た。 走査型電子顕微鏡で得られた薄片を観察した ところ、薄片の全面に気孔があり、その大きさ は約0.1 μ、気孔率約38容量%であった。 実施例2

ブタノール847gにジルコニウムテトラブトキシド1モル(383g)を溶解して均一溶液を作り、そこに水5モル(90g)を混合して、ゾルを作り、さらに平均粒径12nmの微粒シリカ(アエロジル200:日本アエロジル社製)4.0gを超音波分散して原液とした。

これをピーカーに入れ、この液中にスライド ガラスを浸漬して、75cm/分の速度で引き上げた。

このスライドガラスをエアバス中で90℃、30分間乾燥し、ガラス上の薄膜に亀裂を生ぜしめ次いでスライドガラス上の薄膜をスクレーパーで掻き落とし薄片とした後、該薄片を900℃で30分間焼成した。

得られた薄片状ジルコニアは厚み 0.8 μ、大きさ 10~30 μであった。

この薄片を奇性ソ 10%水溶液中に30分間浸漬した後に、取り出し、十分に水洗して多孔質ジルコニア薄片を得た。

この薄片を走査型電子顕微鏡により観察した 所、気孔の直径は0.02~0.5 μで気孔率は約 5 容量%であった。

実施例3

アルミナゾル(アルミナゾル100:日産化学領製)を、アルミナ濃度が10重量%になるように水で希釈し、これにアルギン酸ソーダをアルミナに対して4.2重量%となるように混合溶解して原液とした。

これをビーカーに入れ、スライドガラスをこの液に浸漬後60cm/分の速度で引き上げた。

このスライドガラスをエアバス中で90℃、 30分間乾燥し、スライドガラス上の薄膜に亀 裂を生ぜしめ次いでスライドガラス上の薄膜を スクレーバーで掻き落とし薄片とした後、該薄 片を900℃で30分間焼成した。

このようにして得られた薄片状アルミナの大

このスライドガラスをエアバス中で90で、 30分間乾燥し、スライドガラス上の薄膜に急 裂を生ぜしめ次いでスライドガラス上の薄膜を スクレーバーで掻き落とし薄片とした後、該薄 片を900でで30分間焼成した。

得られた薄片は大きさ8~40μ、厚み約0. 5μの薄片状チタニアであった。

この薄片を走査型電子顕微鏡により観察した 所、薄片の全面に気孔があり、その大きさは約 0.3 µ、気孔率は約50容量%であった。

実施例 5

チタニウムテトラエトキシドの40重量%エタノール溶液200gに、27gのプロピオン酸と、液中のチタン量100重量部(酸化チタン換算)に対して5重量部の酢酸ピニルを加えて、70℃で3時間撹拌混合した後、この液中に洗浄したスライドガラスを浸漬した。

このガラスを 5 0 cm / 分で引き上げた後に、エアバス中で 9 0 ℃、 3 0 分間乾燥後 4 5 0 ℃で 3 0 分間乾燥 0 大きさ 4 μ m、 平

きさは8~50μ、

12 μであった。

この薄片を走査型電子顕微鏡により観察した 所、気孔の直径は約0.1 μで気孔率は約15容 骨分であった。

実施例 4

硫酸チタニルと硫酸を混合してチタン濃度 0. 2 5 モル/ & 、硫酸濃度 0.9 モル/ & の溶液を作った

これをよく撹拌しながら、25重量%の苛性 ソーダー溶液を添加、pH6になるように調整 して24時間撹拌した。

この後、遠心分離水希釈を繰り返して硫酸ナトリウムを除き、チタニア濃度2.8重量%に調整したチタニアゾル液を作った。

更に、これにポリピニルアルコールを 2 4 重量部/酸化チタン 1 0 0 重量部の割合に混合溶解して原液とした。

これをピーカーに入れ、この液中にスライド ガラスを浸漬して、250cm/分の速度で引き トげた

均の厚み 0.3 µ m の薄片状チタニアを得た。

得られた薄片を走査型電子顕微鏡で観察したところ、薄片の全面に気孔があり、その大きさは約0.1 μ、気孔率は約10容量%であった。 実施例6

テトラエチルオルトシリケートの40重量%エタノール溶液に、該溶液中のケイ素の2倍モルのギ酸を加えて、70℃で3時間撹拌混合した後、この液中に平均粒径1μmの酸化マグネシウムを液中のシリカに対して20重量%になるように加え、更に増粘剤としてエチルセルロースを液に対して1重量%添加し、超音波混合

次にこの液中に洗浄したスライドガラスを浸漬し、75cm/分で引き上げた後に、エアバス中で90で、30分間乾燥して、平均の大きさ100μm、平均の厚み3μmの適片を得た。

これを 4 5 0 ℃で 3 0 分間焼成して、平均の 大きさ 6 0 μm、平均の厚み 3 μmの酸化マグ ルシウム分散シリカ薄片を得た。 この薄片を塩酸の1 溶液中に30分間 浸漬した後に、取り出し、十分に水洗して多孔 質シリカ薄片を得た。

この薄片を走査型電子顕微鏡で観察した所、 気孔の大きさ約1 μm、気孔率は約2 0 容量% であった。

実施例?

四塩化スズ1モル(260g)を、2㎏の水に溶解して、これに苛性ソーダ 4 モル(160g)を1㎏の水に溶解したものを滴下して酸化スズのゾルを作り、この後、遠心分離水希釈を繰り返し、更にイオン交換をして塩化ナトリウムを除き、これにカルボキシメチルセルロースを0.9 重量部/酸化スズ100重量部の割合に混合溶解して原液とした。

これをピーカーに入れ、スライドガラスをこの液に浸漬後75cm/分の速度で引き上げた。

このスライドガラスをエアバス中で90℃、 30分間乾燥し、次いでスライドガラス上の薄 片をスクレーパーで掻き落とし、該薄片を90

この薄片を苛性ソーダの10%水溶液中に30分間浸漬した後に、取り出し、十分に水洗して平均の厚み1.5 μ、平均の大きさ30μの多孔質酸化チタン薄片を得た。

この簿片を走査型電子顕微鏡で観察した所、 気孔の大きさは約 0.5 μ、気孔率は 1.5 容量% であった。

実施例 9

リンが 7 重量 %、 A & / P のモル比が 3 の第一リン酸アルミニウム水溶液 1 0 0 重量部に、ポリビニルアルコールを 2 重量部の割合になるように混合溶解して原液とした。

これをピーカーに入れ、この液中にスライドガラスを没漬して、このガラスを50cm/分で引き上げた後、エアバス中で90c、30分間 乾燥し、スクレーパーで掻き取って薄片を得た。

次いでこの薄片を300℃で30分間焼成し ★

このようにして得られた多孔質薄片状リン酸 アルミニウムは平均の大きさ150μ、厚さ5 0 でで 3 0 分間焼成した

得られた薄片状酸化スズは厚み 0.6 μ、大きさ5~20μであった。

この薄片を走査型電子顕微鏡で観察した所、 気孔の大きさは約0.03 μ、気孔率は約5 容量 %であった。

実施例8

四塩化チタン19g(0.1 モル) をメタノール6.4g(0.2 モル) と反応させた後に水42gと混合して薄片形成液を調整した。

この液中に平均粒径 0.5 μmの微粒アルミナ (住友化学製) 1.4 g を加えて超音波混合し、 薄片化原液を作成した。

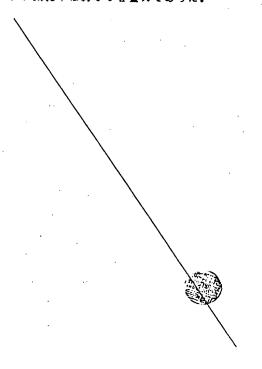
この液に洗浄したライドガラスを浸漬して、 75cm/分の速度で引き上げた。

これをエアバス中で120℃、30分間乾燥 し薄片を得た。

得られた薄片を300℃、5時間、次いで700℃、2時間焼成して微粒アルミナ分散薄片状酸化チタンを得た。

μであった。

この薄片を走査型電子顕微鏡で観察した所、 薄片の全面に気孔があり、その大きさは約0.3 μ、気孔率は約10容量%であった。



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.